



De l'atome à la puce

Devoir surveillé – Décembre 2015

Durée: 1h45 heures Calculatrices interdites (tous types)

Les exercices sont indépendants.

Vous devez expliquer le détail de votre raisonnement. Un résultat non justifié ne suffit pas à obtenir les points de la question.

Les données utiles (vous pourrez éventuellement les arrondir selon les besoins du calcul) :

Soit h la constante de Planck : h = $6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ Soit ϵ_0 la permittivité du vide. ϵ_0 = 8,854 \times 10⁻¹² F m On donne aussi $1/(4\pi\epsilon_0)$ = 8,9 × 10^9 N m² C⁻² $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹ (vitesse de la lumière) Le "gap" du silicium est E_g = 1,12 eV à 25°C On prendra la charge élémentaire e = 1.6×10^{-19} C La constante de Boltzmann vaut k = 1,38 \times 10⁻²³ J K⁻¹ Dans le silicium, μ_p = 0,04 m² V-1 s-1 et μ_e = 0,14 m² V-1 s-1

Exercice 1

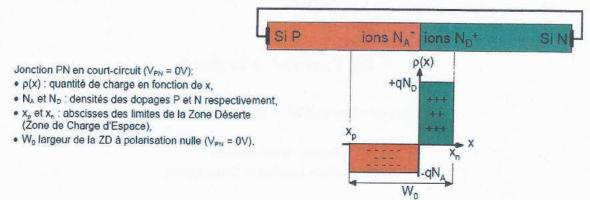
Le silicium est, non dopé, un semi-conducteur intrinsèque. On négligera la présence d'éventuelles impuretés avant dopage. Sa conductivité intrinsèque vaut σ_i = 2,5 \times 10⁻⁴ S.m⁻¹.

- a) Qu'est-ce que le dopage ? Quelle est son utilité ?
- b) Après dopage, un semi-conducteur est-il intrinsèque ou extrinsèque ?
- c) Citez un élément utilisable pour doper n. Justifier.
- d) Calculer la concentration No d'atomes de dopant à introduire dans le Si pour augmenter sa conductivité jusqu'à 150 S.m⁻¹. Justifier et détailler les calculs (préciser notamment les 2 principales hypothèses effectuées).
- e) Vérifier les hypothèses que vous avez effectué à la question d.
- f) On donne les expressions des concentrations en électrons (n) et en trous (p) dans les bandes de conduction et de valence : $n = N_c \times exp[-(E_c-E_F)/kT]$ et $p = N_v \times exp[(E_v-E_F)/kT]$

Calculer la variation de l'énergie du niveau de Fermi (E_F) pour le silicium dopé n de la question b), par rapport au silicium intrinsèque, pour une température de 300K. La représenter sur un schéma d'énergie.

Exercice 2.

On considère une jonction PN:



- a) Dans quel sens diffusent les électrons et les trous ?
- b) Dans quel sens dérivent les électrons et les trous ?
- c) Tracez les concentrations en porteurs de charge p et n dans les différentes zones de cette diode.
- d) Soit E(x) la norme du champ électrique régnant dans la ZCE, et V_{Θ} le potentiel de jonction. Sachant que $V_{\Theta} = -\int_{x_{-}}^{X_{n}} E(x) dx$

et que
$$E(x) dx = \frac{kT}{q} \frac{dp}{p(x)}$$
, démontrez que $V_{\Theta} = +\frac{kT}{q} ln \frac{N_D N_A}{n_l^2}$

(avec ni la concentration de porteurs intrinsèques)

e) Application numérique : Calculez V_{Θ} en considérant $N_A = 10^{16}$ cm⁻³, $N_D = 10^{16}$ cm⁻³, $n_i = 10^{10}$ cm⁻³, T = 300 K, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C et $k = 1,38 \times 10^{-23}$ J K⁻¹.

Exercice 3.

a) Donnez la représentation schématique conventionnelle d'un nMOS.

b) Que signifie l'acronyme MOSFET?

c) Porte logique « NOR »

c1) Transistor nMOS

Explicitez le fonctionnement d'un transistor nMOS en répondant aux questions suivantes :

* Montrez que les jonctions PN présentes sont toutes « bloquées » si Body, Source, Drain et Gate sont au même potentiel.

* Si V_G > 0:

- Que se passe-t-il?

- Dans quel sens circule ce courant ?

* Discutez de l'état « passant » ou « bloqué » du transistor nMOS en fonction du potentiel de Gate (faites un tableau récapitulatif).

c2) Transistor pMOS

Discutez de l'état « passant » ou « bloqué » du transistor pMOS en fonction du potentiel de Gate (faites un tableau récapitulatif).

c3) Porte NOR

Faire le schéma électrique d'une porte NOR (les différents transistors pMOS et nMOS doivent apparaître).

d) Donner la table de vérité de cette porte NOR.

e) En raisonnant sur le caractère passant ou bloquant des transistors, expliquez électriquement la table de vérité.